#### 科学研究費助成專業 研究成果報告書



平成 28 年 6 月 1 日現在

機関番号: 13501

研究種目: 基盤研究(C)(一般)

研究期間: 2013~2015

課題番号: 25390094

研究課題名(和文)超高強度超短パルスボーティクス・ベクトルビームを用いた非線形光学の新展開

研究課題名(英文) Recent progress of nonlinear optics with vortex vector beams for high intensity and ultrashort laser pulses

研究代表者

張本 鉄雄(HARIMOTO, Tetsuo)

山梨大学・総合研究部・教授

研究者番号:80273035

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,900,000円

研究成果の概要(和文): 本研究は螺旋状位相と径偏光及び方位方向偏光を考慮した Sパラメータによる非線形光学システムの簡易な光学設計法を確立した。非臨界位相整合方式のタイプ I LBO結晶を用いて、径偏光基本波ビームが二枚の結晶を透過することで、基本波と同様なドーナツ型の第二高調波ビームが得られることを明らかにした。集光ビームがラインビームに近い楕円形ビーム生成システムの精密制御も行い、今後のベクトルビームを用いた材料加工への応用に関わる工学的な課題を評価した。楕円形ビームシステムの特性実験結果より回折限界レベルの集光特性が得られたことが示され、実用化に必要とするシステムの再現性、安定性及び正確性も確認された。

研究成果の概要(英文): The possibility of optimization design of the nonlinear optical system with parameter S is explored in consideration of the spiral phase and radial or azimuthal polarization, and a simple design method with S is set up for ultrahigh intensity and ultrashort laser pulses. A new scheme of the second-harmonic generation with a radially-polarized fundamental donut beam through two type I LBO crystals is proposed, and the second-harmonic beam with the same profile as that of the fundamental beam is numerically demonstrated. Operation properties of an optical system for elliptical beam generation is investigated in order to estimate practical issues on the application with a vortex vector laser beam to material processing. Experimental results of system characteristics showed that the focal line width at the focal point is the same as that of the diffraction limitation. The reproducibility, stability and accuracy of the system that need to commercialization are also confirmed.

研究分野: レーザー工学と非線形光工学

キーワード: ボーテックス・ベクトルビーム 第二高調波発生 光パラメトリックチャープパルス増幅 非線形光学 効果 ビーム形状最適化

#### 1.研究開始当初の背景

空間的位相(ボーティクス:Vortex/渦)・偏 光分布(ベクトル)を制御したレーザービーム として、光軸付近に穴の空いた強度分布をも つドーナツ型のラゲールガウシアン (Laguerre-Gaussian: LG)ビームが注目され ている。螺旋構造の位相分布に起因する光の 軌道角運動量は光ピンセットや、マイクロ操 作及びナノ金属針の加工に応用されつつあ る。また、光の電場が放射状に分布している 径偏光ビームや方位方向に分布している方 位偏光ビームの強度分布も同じドーナツ型 であるが、径偏光ビームは集光すると、電場 ベクトル合成の結果としてガウシアンビー ムに比べより小さなスポットサイズが得ら れるため、材料加工及びレーザープラズマ相 互作用への応用に大いに期待されている。

ボーティクス・ベクトルビーム光学及び光 の軌道角運動量の研究は主にオランダを中 心とした欧州で盛んに展開されている。日本 では、電気通信大学、北海道大学と千葉大学 はボーティクスとその加工への応用研究を 展開して、ボーティクスの発生や非線形光学 効果を用いたボーティクス制御に関して多 数の成果を公表し、特にボーティクスレーザ ービームを用いて直径 50 nm 長さ 10 μm の 世界で最も細い金属針を作ることに成功し た。東北大学は第二高調波発生の遠視野ビー ムパターンを通じて軸方向における電場の 観測に成功した。大阪大学は液晶の旋光性を 利用して偏光位相板と位相シフターとの組 み合わせで高強度レーザーにも適応できる ベクトルビーム及びそのレーザープラズマ 相互作用への応用可能性を示した。

しかし、材料加工やレーザープラズマ相互 作用等への応用にはボーティクス・ベクトル レーザービームを更なる高出力化及び短短 長化することが不可欠となってきて、そのた めボーティクス・ベクトルビーム非線形光の構築は重要な課題として浮上してきた。 のような背景から、本研究では、第二別ルス 発生及び光パラメトリックチャープパト・レー 増幅を用いて、テラワット~ペタワット・レー ザービームの発生・強度増幅・短波長変及 びその材料加工への応用に取り組んできた。

## 2.研究の目的

本研究は超高強度超短パルスボーテックス・ベクトルレーザービームの非線形光学特徴を明らかにすることが目的である。第二高調波発生を用いたボーテックス・ベクトルーザービームの短波長化と、パラメトリックチャープパルス増幅による高出力化・極短パルス化は本研究の主要な内容であり、テラワット~ペタワット・サイクルパルスのボーと、ックス・ベクトルレーザービームの実用化実験の両面で明らかにする。

### 3.研究の方法

本研究は二次の非線形光学過程における 逆変換効果に着目し、位相不整合を取り入れ た第二高調波発生によるラゲールガウシア ンビームの発生方法を考案し、その可能性を 検証する。また、ラゲールガウシアンビーム とエルミートガウシアン(Hermite-Gaussisan: HG)ビームとの関係より二段階の非線形光学 過程を用いたボーテックス・ベクトルレーザ ービームの短波長化と高出力化及び極短パ ルス化の考案の実用可能性も数値解析によって明らかにし、ペタワット・サイクルパル ス級のボーテックス・ベクトルビームの非線 形光学の理論基礎も完成させる。

(1)ボーティクス・ベクトルビームの非線形 光学の理論基礎の構築

ガウシアンビームに対応する第二高調波 発生及びパラメトリックチャープパルス増幅に関する非線形波動方程式の数値計算コードをベクトル量に対応させ、ボーティクス・ベクトルビームの空間分布と偏光分布及び方位方向の位相分布を新たに加えることで、ボーティクス・ベクトルビームを用いた非線形光学の理論及び数値解析を実施し、高効率第二高調波発生及び高利得パラメトリックチャープパルス増幅に関わる課題を理論的に明らかにさせる。

(2)二次の非線形光学過程によるラゲールガウシアンビーム発生の実証

(3)二段階の非線形光学過程によるボーティクス・ベクトルビームの短波長化と高強度化の試み

径偏光と方位方向偏光のラゲールガウシアンビームは二つの直線偏光エルミートガウシアンビームに分解することが可能であり、非線形光学過程を二つの偏光成分にそれぞれ対応させる二段階に分けて実施すれば、高効率第二高調波発生と高利得パラメトリできる。一枚目の非線形光学結晶の常光線軸を鉛直偏光成分に対応させ、この成分のとで設して対応では強度増幅をさせる。残りの水平偏光成分は一枚目結晶の異常光の地と同じ偏光方向になったため、結晶をのまま通過する。二枚目の非線形光学結晶の常

光線軸と異常光線軸は一枚目のそれらと 90 度回転して設置することによって、水平偏光成分も非線形光学過程に関わり、方位偏光の第二高調波の発生やシード光の強度増幅が可能になる。同様に方位偏光ベクトルビームを用いた場合には径偏光ビームを得ることが可能である。本研究では、波長 1053 nm の高出力パルスベクトルレーザービームを基本波としてタイプ I の LBO 結晶による波長532 nm のラゲールガウシアンビームの発生の可能性を検証する。

(4)ボーティクス・ベクトルビームに関する ΔS パラメータ光学設計法を確立

研究代表者は、非線形波動方程式より二次の非線形光学過程における規格化された位相整合ファクター $\Delta S$  と変換効率との解析に 個整合ファクター $\Delta S$  と変換効率との解析に 相整合ファクター及び入射レーザー先頭 度に対応する最適な非線形光学結晶の 度に対応する最適な非線形光学結晶の を解析的に設計することができるように を解析的に設計することができるように がでは、螺旋状位相分の るよる非線形光学システムの最 制の可能性を探り、それに関する課題を解決 すると共に高強度サイクルパルスボーメ り、イクトルビームに関する  $\Delta S$  パラメータ光学設計法を確立する。

高出力ボーティクス・ベクトルビームを用いた材料加工(半導体ウェハーのダイシング等)への応用に必要な実用的な光学系の設計や再現性の向上に関わる課題を明らかにする。

# 4. 研究成果

(1)ΔS パラメータを用いた二次非線形光学過程の最適化

二次の非線形光学効果を用いたレーザー 光の短波長化及びその増幅においては、主に 第二高調波発生と光パラメトリック増幅効 果が利用される。高効率を得るために、入射 レーザー光と非線形光学結晶の最適化が必 要である。強度や波長及び偏光方向が一定で あるレーザーパラメータに対して、非線形光 学結晶の位相整合角とその長さの最適化方 法としては、非線形波動方程式より導かれた 楕円関数法が挙げられる。変換効率を除く小 信号近似も初歩的な方法として第二高調波 発生や光パラメトリック増幅の評価によく 利用されている。また、パソコンの計算速度 の進歩と数値計算ソフトの高機能化によっ て、非線形波動方程式を直接に利用して数値 計算による最適化も一般的に行えるように なった。本研究は二次の非線形光学過程にお ける変換と逆変換の周期性に着目し、第二高 調波発生及び光パラメトリック増幅の変換 効率にも対応できる近似解析式を導くこと ができた。また、非線形波動方程式を記述す る ΔS パラメータを利用して二次の非線形光 学過程を評価できることから、ΔS パラメータ を用いた二次の非線形光学過程の簡易な最 適化方法を確立した。

角周波数 $\omega_{\rm m}$  (m=1, 2, 3)のレーザー光による 三波混合( $\omega_{\rm l}+\omega_{\rm 2}=\omega_{\rm 3}$ )に対応する特性因子である  $\Delta S$  パラメータは、次式

 $\Delta S = (k_3 - k_2 - k_1)/\sqrt{2d_{eff}^2 I_{,}}O_{i}O_{2}/\epsilon_{0}c^{3}n_{i}n_{2}n_{3}}$ で表される。ここで、 $n_{m}$  は屈折率、 $k_{m}$  は波数、c は真空中の光速、 $\epsilon_{0}$  は真空中の誘導率、 $d_{eff}$  は非線形光学常数、 $I_{t}$  は入射レーザーの総強度である。 $\Delta S$  パラメータには入射レーザー光の強度と波長、非線形光学結晶の屈折率と非線形光学常数、結晶中における波数ベクトルの差(位相不整合要素)がすべて含まれている。三波混合のような非線形光学過程の最適化では、入射レーザー光の波長と強度が一定であれば、非線形光学結晶の位相整合角とその長さは最適化対象となる。位相整合角は従来の位相整合条件によって決められるが、最適な結晶長さは式

 $L \approx \ln \left( 16/|\Delta S| \right) / \sqrt{\varepsilon_0 c^3 n_1 n_2 n_3 / 8 d_{eff}^2 I_* \omega_1 \omega_2}$  で評価することができる。このときの  $\Delta S$  パラメータを最大強度変換率 $\eta_{\rm max}$ との関係式

$$\Delta S = 2(1 - \eta_{\text{max}}) / \sqrt{\eta_{\text{max}}}$$

に置き換えることによって、 $\eta_{max}$ に対応する最適な結晶長さLが求められる。 $\eta_{max}$ =1は理論的に最適な条件であるが、実際にレーザービーム発散角やバンド幅を無視できないため、結晶の最適化設計では、ビーム発散やバンド幅を  $\Delta S$  に寄与することによって最適な結晶長さを決める。光パラメトリック増幅も同じように最適化できる。

(2)二次の非線形光学効果における位相不整 合の近似解析法

二次の非線形光学効果に基づいた非線形光学結晶のパラメータの最適化設計や変換効率の定量化評価は非線形波動方程式で数値計算を通じて行うことが一般的方法として行うことが一般的方法としてある。小信号近似は、解析的な手法としてると換効率を除いた非線形光学過程におけてるを換効率を除いた非線形光学過程におけてある。また、非線形波動方程式を有り関数で表示することで、プログラムによるとで、プログラムによりに計算をせずに非線形光学過程を解析のに評価できる。しかし、楕円関数を用いた方法は物理的にイメージすることが容易でなく、より簡単な設計法は常に求められている。

非線形波動方程式を用いて、二次の非線形 光学過程は主に変換領域(小信号領域)、飽和 領域及び逆変換領域に分けて別々にそれら の特徴を評価することができる。非線形光学 効果の最も重要な特徴は変換効率であり、こ れを評価するには小信号領域だけでなく飽 和領域を含めた設計法が必要である。本研究 は非線形波動方程式により規格化されたパ ラメータ を用いた二次の非線形光学過程に おける位相不整合要素と変換効率の関係を 解析的に明らかにし、さらに群速度不整合ま で広げることに成功した。

 $\omega_1 + \omega_2 = \omega_3$ のような二次の非線形光学過程は  $\Delta S$  パラメータと規格化された非線形光学

結晶長のみに依存する。第二高調波最大強度 の半分のところで小信号近似を飽和近似の 結果と等しくさせると、第二高調波最大強度 値に対応する結晶長 L は

$$\begin{split} L \approx & \frac{1}{2d_{eff}} \sqrt{\frac{\varepsilon_0 c^3 n_1 n_2 n_3}{2I_t \omega_1 \omega_2}} \times \\ & ln \left[ \frac{16d_{eff}}{\left| 2/v_3 - 1/v_2 - 1/v_1 \right| \left| \Delta \omega_1 \right|} \sqrt{\frac{2I_t \omega_1 \omega_2}{\varepsilon_0 c n_1 n_2 n_3}} \right] \end{split}$$

で与えられる。ここで、 $\Delta \omega_1$ は基本波のバンド幅、 $v_1$ 、 $v_2$ 、 $v_3$  は群速度である。この式は 非線形光学結晶のパラメータ  $(n_1,n_2,n_3,d_{e\!f\!f})$ と入射する基本波のパラメータ $(\omega_1,\omega_2,\omega_3,I_i)$ によって構成され、ピコ秒領域における群速度不整合を含めるものである。更に群速度分散を取り入れることでフェムト秒レーザーパルスにも対応できる。

(3)第二高調波発生を利用したドーナツ型ビームの時間分布特性

波長変換として多く用いられている第二高調波発生に位相不整合因子を加えることで、ガウス型の基本波ビームから第二高調波ドーナツ型ビームを生成することを明らかにした。本研究では生成したドーナツ型ビームの時間分布特性についての数値的解析を行った。非臨界位相整合方式のタイプILBO結晶を用い、位相整合温度にすることで第二高調波を発生させる。

数値解析より、位相不整合因子を加えた出射ビーム強度が結晶長に対して周期性を示すことが明らかになった。その周期性は基本波と第二高調波における変換周期であり、この周期を求めることにより基本波と第二高調波それぞれのドーナツ型の設計式を求めることが可能である。基本波  $L_{10}$ と第二高調波  $L_{20}$ がドーナツ型ビームになる結晶長の設計値はそれぞれ次式

$$L_{1\omega} = (2n-1)L$$
,  $L_{2\omega} = 2nL$ 

で与えられる。ここで、L は第二高調波最大 強度値(1/2 周期)に対応する結晶長、n は自 然数である。これらの式より、結晶長が 1/2 周期の奇数倍の時は基本波のドーナツ型ビー ム、偶数倍の時には第二高調波のドーナツ型 ビームが設計できる。ビームの中心強度が 0 になるのは第二高調波だけである。そのため、 理想的なドーナツ型ビームは第二高調波ドー ナツ型ビームにおいて設計した。入射基本波 強度を 1.5 GW/cm<sup>2</sup> 結晶を 23.3 mm、LBO 結 晶の温度変化を 0.01 (1.4256 m<sup>-1</sup>) とし、ド ーナツ型の第二高調波ビームを得られること が示された。時間分布において、ドーナツ中 心ではドーナツ分布をしており中心強度が 0 になっていることが明らかにでき、ドーナツ のリングの時間分布は、ガウス分布であり最 大強度をとることが明らかになった。理想的 な第二高調波ドーナツ型ビームは、時間分布 においても理想的な分布を示しておりドーナ

ツ型の特性を持っていることが示された。 (4)二段階の第二高調波発生を用いた径偏光 ベクトルビームの短波長化

本研究は二段階の第二高調波発生を用いた径偏光ベクトルビームの短波長化の可能性に関する評価を行った。

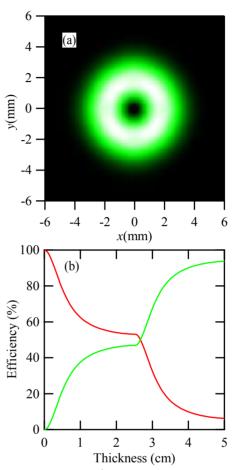


図1 径偏光ビームの第二高調波発生

径偏光ベクトルビーム LG01 が二つの Hermite-Gaussian モード成分 HG10 と HG01 によって構成されることから、二段階の第二 高調波発生方式を考案した。一枚目結晶では 常光線偏光の HG01 成分が第二高調波に変 換され、異常光線偏光の HG10 成分はそのま ま通過する。二枚目結晶の光軸を 90 度回転 させることにより、一枚目結晶での常光線偏 光が異常光線偏光に、異常光線偏光が常光線 偏光へと変わる。これにより一枚目結晶で変 換されなかった異常光線偏光の HG10 成分 が第二高調波に変換され、一枚目結晶で変換 された常光線偏光の HG01 成分はそのまま 通過する。二枚目の結晶透過後に各偏光成分 のビームは合成され、径偏光ベクトルビーム は第二高調波ビーム(LG01)に変換されたこ とになる。

非臨界位相整合方式のタイプ I LBO 結晶 (長さ  $2.5~{\rm cm}$ 、 $\theta$ = $90^{\circ}$ 、 $\Phi$ = $0^{\circ}$ )を用いて、第二 高調波を発生させる数値評価を行った。数値計算では、LBO 結晶の位相整合温度を  $147.5~{\rm と}$  し、基本波は  $1064~{\rm nm}$ 、強度  $2.0~{\rm GW/cm}^2$  の径偏光ベクトル基本波ビームを用

いた。径偏光ベクトル基本波ビームが二枚のLBO結晶を透過することで、基本波と同様なドーナツ型の第二高調波ビームを得ることができ、エネルギー変換効率はそれぞれの結晶ごとに、ほぼ限界に達したことを確認できた。

現時点での第二高調波発生は結晶ごとの位相のずれが生じないものと仮定して数値計算を行っている。しかし、実際に各成分を合成する際に位相のずれが生じるため、今後は位相のずれを考慮した第二高調波の発生が必要である。

(5)材料加工への応用におけるビーム光学系 の高精度制御

本研究では、集光ビーム分布がラインビームに近い楕円形ビーム生成システムの精密制御も行い、今後のベクトルビームを用いた材料加工への応用に関わる工学的な課題を評価した。

レーザーダイシングでは半導体ウェハに 集光するビームは、通常のガウス型強度分布 を持つ円形ビームを用いるよりもトップハット型を有する方形ビームや楕円形ビーム の方が有効である。これらのラインビームを 用いることで、より均一な照射が可能となり、 ダイシング時の集光スポットの重なりを考 慮せずにダイシング速度の高速化が実現可 能となる。

レーザーを用いた半導体ウェハ加工においては、半導体ウェハに集光したビームサイズとその位置の最適化は照射レーザーパワーと同様に重要な要素である。本研究で実施した楕円形ビーム生成システムの設計は、従来の光学原理に基づいたものであるが、実用化の観点から精密制御に関わる光学部品数を最小限に抑えている。また、レーザービームの集光サイズとその位置のコントロールもシステムの外観寸法を変えずに行えるようになっている。

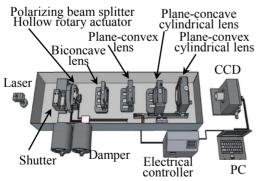
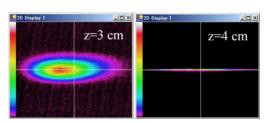


図2 楕円ビームシステムの構成図

図 2 に示す楕円形ビームユニットは、レーザーダイシングを最適化するために必要なレーザーパワー制御系、円形ビーム拡大系と楕円形ビーム制御系によって構成され、市販の光学部品が用いられている。レーザーパワー制御系には 1/2 波長板とキューブ型偏光ビームスプリッタが用いられ、ビームスプリッタを透過したレーザーパワーの調整役割を

担う。1/2 波長板の回転を中空ロータリーア クチュエータで精密にコントロールするこ とによって半導体ウェハ加工に必要なレー ザーパワーの調節が可能となっている。ビー ムスプリッタに反射されたレーザービーム はダンパーによって処理される。円形ビーム 拡大系には、両凹球面レンズと平凸球面レン ズが用いられている。また、楕円形ビーム制 御系は平凹シリンドリカルレンズと平凸シ リンドリカルレンズから構成されている。平 凹シリンドリカルレンズを電動スライダで 駆動することで、二つのシリンドリカルレン ズの間隔を高精度で制御し、半導体ウェハに 集光したビームサイズを精密に調整するこ とができる。この楕円形ビームユニットで基 本波波長 1064 nm の Nd:YVO4 レーザーの第 二高調波 (532 nm ) 第三高調波 (355 nm ) 及び第四高調波 (266 nm) の円形ビームを楕 円形ビームに変換させる. それぞれのレーザ - 波長に応じて各光学系にある光学部品を 切り替える。基本波の繰り返し周波数の変化 範囲 20~100 kHz に対して、パルス幅は 14~ 26 ns で、最大平均出力パワーは 20 W である. 光学系の光学部品もナノ秒の高エネルギー レーザに対応するものを用いる。楕円形ビー ム光学系の集光特性の評価は、図2に示すよ うに、CCD イメージセンサで行うが、レーザ -ダイシングを施す時には、この CCD イメ ージセンサは X-Y ステージに切り替えられ、 X-Y ステージと連動することによって、集光 ビームの大きさのみならず、その位置も制御 できる。



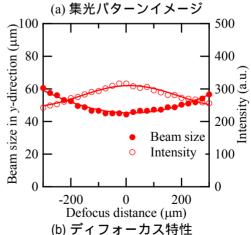


図3 楕円ビーム光学システムの ディフォーカス特性

半導体ウェハの加工特性に大きく影響を 及ぼすレイリー長さを考慮して、スポットサ イズ $\sqrt{2}$  倍の前後位置までのデフォーカス特 性を測定した(図3)。シリンドリカルレンズCL1とCL2の初期間隔 z を 4 cm に設定するときに、y 方向の最小ビームサイズは 47 μmとなり、回折限界時の理論評価結果と同じである。また、z を 8 cm と 5.5 cm に設定すると、y 方向の最小ビームサイズはそれぞれ16.8 μm、23.8 μmとなり、これらの結果も回折限界時の理論評価結果とほぼ同じである。デフォーカスによるレーザー強度の変化から、最小ビームサイズに近づくにつれて光強度は増加し、最小ビームサイズを過ぎると減少していくことも確認された。

## 5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

#### [雑誌論文](計3件)

太田 由香、松坂 浩志、<u>張本 鉄雄</u>: " 楕 円形ビーム光学系の動作特性"、精密工 学会誌 Vol. 82、No.2、163-167 (2016) (査 読有)。

Tetsuo Harimoto and Hidetomo Tsugane: "Dynamic properties of second-harmonic intensity of a nanosecond-order laser pulse", Optical Review, Vol. 21, No. 3, 265-269 (2014) (查読有)。

Tetsuo Harimoto: "Simple method of optimizing second-harmonic generation under imperfect phase-mismatching conditions caused by group-velocity mismatch and group-velocity dispersion", Jpn. J. Appl. Phys., Vol.53, No.3, 038003-1-3 (2014) (查読有)。

#### [学会発表](計7件)

田村 大、<u>張本 鉄雄</u>: "二段階の第二高調波発生を用いた径偏光ベクトルビームの短波長化"、2015年第76回応用物理学会秋季学術講演会、予稿集 DVD、03-226、名古屋国際会議場、2015年9月14日、講演番号14p-PA1-3。

長田 基希、張本 鉄雄: "第二高調波発生を利用したドーナツ型ビームの時間分布特性"、日本光学会年次学術講演会、筑波大学東京キャンパス文京校舎、2014年11月7日、講演番号7pP3。

張本 鉄雄: "特性因子 Sを用いた二次 非線形光学過程の最適化、" 2014 年 第 75 回応用物理学会秋季学術講演会、予稿 集 DVD、03-124、北海道大学札幌キャン パス、2014 年 9 月 18 日、講演番号 18p-PA3-1。

長田 基希、<u>張本 鉄雄</u>: "第二高調波発生 を利用したドーナツ型ビームの生成"、 2014 年 第 61 回応用物理学会春季学術 講演会、予稿集 DVD、04-157、青山学院 大学相模原キャンパス、2014 年 3 月 18 日、講演番号 18p-PA4-1。

小林 由佑、張本 鉄雄、松坂 浩志:" 精

円レーザービーム自動調整光学系の制御"、第14回レーザー学会東京支部研究会、講演予稿集、P-3、p.2、東海大学高輪湘南キャンパス、2014年3月5日。近藤 勝仁、張本 鉄雄: "光パラメトリック増幅効果を用いたドーナツビームの発生"、第14回レーザー学会東京支部研究会、講演予稿集、P-4、p.2、東海大学高輪湘南キャンパス、2014年3月5日。

張本 鉄雄: "二次の非線形光学効果における位相不整合の近似解析法"、日本光学会年次学術講演会、奈良県新公会堂、2013年11月12日、講演番号12pP4。

## 6. 研究組織

#### (1)研究代表者

張本 鉄雄(HARIMOTO Tetsuo) 山梨大学・大学院総合研究部 教授 研究者番号:80273035

(2)研究分担者

( )

研究者番号:

(3)連携研究者

)

研究者番号: